

投稿論文

【電子分野】

〔第7章〕有機ELデバイス製造時の汚染解析技術 - デバイス劣化因子の推定 -

〔書籍〕「最先端の有機EL - 基礎物理・材料化学・デバイス応用と解析技術 -」（発行：株式会社シーエムシー出版），348-356（2017）

末包高史，今西克也，藤本 弘*（技術開発センター，*有機光エレクトロニクス実用化開発センター）
九州大学の安達教授，客員准教授が編集した有機EL専門書への分担執筆。素子劣化の原因として，真空蒸着チャンバー内に存在している極微量の有機不純物が有機半導体材料の蒸着中に混入するためであることを当社有機不純物分析技術により明らかにした。

Determination of Trace Elements in Sintered and Single-Crystal Silicon Carbide by Laser Ablation in Liquid Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

「Analytical Sciences」 (Anal.Sci.発行)，33 (4) 537-544 (2017)

町田 亮，西岡利奈，藤原 正英*，古田直紀*（千葉ラボラトリー，*中央大学理工学部）

Laser Ablation in liquid (LAL) sampling は数 μm の粒子を生成できる事から，難分解性の結晶を溶解しやすい形態にする事ができる。本研究では従来の湿式分解では完全分解できなかった単結晶 SiC を分解し，ICPMS で定量する事に成功した。また，LAL-ICPMS は溶液検量線を用いて定量できる事から，定量値の信頼性が高いことについて言及した。

口頭発表

【電子分野】

FPD 関連電子材料の分析技術の紹介

行嶋史郎（電子事業部）

第27回ファインテックジャパン（東京ビックサイト），2017年4月5日-4月7日

各種分析を用いた有機EL開発支援

大図佳子（筑波ラボラトリー）

日本表面科学会第2回関東支部講演大会（東京大学 山上会館 2階大会議室），2017年4月8日

【工業支援分野】

分析的視点から見た異物混入の発生要因から効果的な分析手法，原因究明・防止策まで

末広省吾（大阪ラボラトリー）

㈱情報機構主催セミナー（きゅりあん（品川区立総合区民会館） 東京），2017年4月17日

反応危険性物質の安全管理について

菊池武史（工業支援事業部）

㈱技術情報協会主催セミナー「化学工場における安全対策」（㈱技術情報協会セミナールーム 東京・

五反田), 2017年4月18日

【工業支援分野・電子分野】

医療機器・医療材料開発支援

佐渡 学 (工業支援事業部)

MEDTEC Japan 2017 (東京ビックサイト), 2017年4月19日-4月21日